Abstract of Japanese Patent Publication

Patent Publication No. 2002-278100

Publication date: September 27, 2002

Request for Examination: None

Patent Application No. 2001-81966

Application date: March 22, 2001

Inventor(s): Ken Tazaki et al

Applicant: Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.

Title of the invention: Electro photoconductor

(Names of individuals and corporation have been translated phonetically)

[Problem] To provide an electro photoconductor with more excellent abrasion resistance than conventional electro photoconductor.

[Means for solving] An electro photoconductor having a photoconductor layer on an electroconductive substrate, wherein a binder resin for the electro photoconductor layer is a polycarbonate to be derived from the formula (A), the formula (B) and the formula (C); a molar ratio of the formula (A)/the formula (B) is 70/30 to 5/95 and a molar ratio of the formula (C)/ [the formula (A) + the formula (B)] is 50/50 to 0/100 and its limiting viscosity is 0.3 to 2.0 dl/g.

$$(R_1)_m$$
 $(R_2)_n$ $(R_3)_p$ $(R_4)_q$ $(R_4)_q$ $(R_5)_p$ $(R_4)_q$

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2002-278100 (P2002-278100A)

(43)公開日 平成14年9月27日(2002.9.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I			テーマコート*(参考)
G 0 3 G	5/05	101	G 0 3 G	5/05	101	2H068
C 0 8 G	64/00		C 0 8 G	64/00		4J029

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願2001-81966(P2001-81966)	(71)出顧人	000004466		
			三菱瓦斯化学株式会社		
(22)出願日	平成13年3月22日(2001.3.22)		東京都千代田区丸の内2丁目5番2号		
•		(72)発明者			
			茨城県鹿島郡神栖町東和田35番地 三菱瓦		
			斯化学株式会社庫島工場		
		(72)発明者			
		(12/)09/14	茨城県鹿島郡神栖町東和田35番地 三菱瓦		
			斯化学株式会社鹿島工場		
		±.			
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 従来の電子写真感光体に比べて、体磨耗性の 良好な電子写真感光体を提供する。

【解決の手段】 導電性基体上に、感光層を有する電子写真感光体において、感光層のバインダー樹脂として、一般式(A)、一般式(B)および一般式(C)から誘導されるポリカーボネートであって、一般式(A)/一般式(B)のモル比が70/30~5/95であり、一般式(C)/[一般式(A)+一般式(B)]のモル比が50/50~0/100であり、かつ極限粘度が0.3~2.0dl/gであることを特徴とする電子写真感光体。

$$(R_1)_m$$
 $(R_2)_n$ OH

$$HO \xrightarrow{(R_a)_p} X \xrightarrow{(R_A)_q} OH \qquad (C)$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性基体上に、感光層を有する電子写真感光体において、該感光層のバインダー樹脂として、一般式(A)、一般式(B)および一般式(C)から誘導されるポリカーボネートであって、一般式(A)/一般式(B)のモル比が70/30~5/95であり、一般式(C)/[一般式(A)+一般式(B)]のモル比が50/50~0/100であり、かつ極限粘度が0.3~2.0dl/gであることを特徴とする電子写真感光体。

【化1】

$$(R_1)_m$$
 $(R_2)_n$ OH (A)

(式中、 $R_1 \sim R_2$ はそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $1\sim20$ のアルコキシル基、炭素数 $6\sim20$ のアリール基、炭素数 $6\sim20$ のシクロアルキル基、炭素数 $6\sim20$ のシクロアルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリールオキシ基を示す。またm及びnは $0\sim4$ の整数を表す。)

【化3】

【化2】

$$HO \xrightarrow{(R_q)_p} X \xrightarrow{(R_4)_q} OH \qquad (C)$$

(式中、R3 及びR4 は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシル基、炭素数6~20のシクロアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数6~20のアリールオキシ基を表し、p及びqは、0~4の整数を表す。Xは、-C(R5)(R6)-、-O-、-CO-、-S-、-SO-または-SO2-であり、R5 及びR6 は、そ 40れぞれ独立に水素原子、炭素数1~10のアルキル基または炭素数6~10のアリール基であり、R5 とR6 とが結合して脂肪族環を形成していても良い。)

【請求項2】 一般式(C)中のR5 及びR6 がメチル 基である請求項1記載の電子写真感光体。

【請求項3】 一般式 (A) が9,9-ビス (4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) フルオレンである請求項1 記載の電子写真感光体。

【請求項4】 一般式(A)が9,9-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)フルオレンであり、一般式(B)

がトリシクロ (5. 2. 1. $0^{2.6}$) デカンジメタノール であって、それらの純度が9.9%以上に製精されたもの である請求項1 記載の電子写真感光体。

【請求項5】 一般式(A)、一般式(B) および一般式(C)を、炭酸ジエステルと、塩基性化合物触媒下、溶融重縮合させて得られるポリカーボネートである請求項1記載の電子写真感光体。

【請求項6】 一般式(A)、一般式(B)および一般式(C)の合計量1モルに対して、10-9~10-3モルの塩基性化合物からなる触媒を用いる請求項6記載の電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子写真感光体に 関する。更に詳しくは、特定のポリカーボネート樹脂を バインダーとして使用した電子写真感光体に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】現在、電子写真技術は、その高速性、高 画質である事等により、複写機、レーザープリンター、 ファックス等に広く応用されている。この電子写真技術 における電子写真感光体としては、従来は、セレン、セ レン/テルル合金、セレン/砒素合金、硫化カドミウム 等の無機系光導電性物質が主に用いられてきた。しか し、毒性、安全性、価格、生産性、等の点から、最近で は、有機系光導電性物質を使用した電子写真感光体が開 発されている。

【0003】この有機系光導電性物質が低分子物質の場合、バインダー樹脂と混合して塗膜を形成する事が通常30 行われている。バインダー樹脂としてはポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等のビニル重合体、及びその共重合体、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスルフォン、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の各種の熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂が用いられてきている。これら各種樹脂の内、ポリカーボネート樹脂が比較的優れた特性を有しており、良く用いられている。

【0004】バインダー樹脂として各種のポリカーボネート樹脂を用いる事が報告されており、例えば特開昭60-172044にはビスフェノールZからのポリカーボネート樹脂が、特開昭63-170647にはビスフェノールAからのポリカーボネート樹脂がそれぞれバインダー樹脂として使用する事が開示されている。

【0005】これらの公知有機系光導電性物質(OPC)と各種バインダー樹脂とを使用する電子写真感光体(OPC感光体)においては、感度等の点では無機系光導電性物質を使用した電子写真感光体に匹敵するものが得られている。

【0006】これらOPC感光体は、キャスト製膜法に 50 より容易に薄膜とする事が可能で、大量生産に向いてお

り、価格も比較的安価である。OPC感光体はこのよう に優れた面がある反面、耐磨耗性が劣る問題があり、改 善が要求されていた。

【0007】一方、特開平1-318065のようにビ スフェノールSからのポリカーボネート樹脂が知られて おり、特公昭48-38430には電子写真感光体のバ インダーへの使用も開示されているが、前記従来のバイ ンダー樹脂に比べ耐磨耗性は必ずしも優れているもので はなかった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、従来 の有機電子写真感光体に比べて、耐磨耗性の良好な有機 電子写真感光体を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、従来の課 題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、特定ポリカーボ ネート樹脂をバインダーとして用いた電子写真感光体は 良好な耐磨耗性を有することを見いだし、本発明を完成 するに至った。

[0010]

【発明の実施の形態】即ち、本発明は、導電性基体上 に、感光層を有する電子写真感光体において、該感光層 のバインダー樹脂として、一般式(A)、一般式(B) および一般式(C)から誘導されるポリカーボネートで あって、一般式(A)/一般式(B)のモル比が70/ 30~5/95であり、一般式(C)/〔一般式(A) +一般式(B)]のモル比が50/50~0/100で あり、かつ極限粘度がO. 3~2. Odl/gであることを 特徴とする電子写真感光体である。

【化4】

$$(R_1)_m$$
 $(R_2)_n$ OH

(式中、 $R_1 \sim R_2$ はそれぞれ、水素原子、ハロゲン原 子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のア ルコキシル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数6 ルコキシル基または炭素数6~20のアリールオキシ基 を示す。またm及びnは0~4の整数を表す。)

(化5)

【化6】

$$HO \xrightarrow{(R_g)_p} X \xrightarrow{(R_\ell)_q} OH \qquad (C)$$

(式中、R3 及びR4 は、それぞれ独立に水素原子、ハ ロゲン原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~ 20のアルコキシル基、炭素数6~20のシクロアルキ ル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数6~20の シクロアルコキシル基または炭素数6~20のアリール オキシ基を表し、p及びqは、0~4の整数を表す。X tx, -C (R₅) (R₆) -x, -CO - x, -CO - x, -S - x-SO-または-SO2 -であり、R5 及びR6 は、そ れぞれ独立に水素原子、炭素数1~10のアルキル基ま たは炭素数6~10のアリール基であり、R5 とR6 と が結合して脂肪族環を形成していても良い。)

【0011】本発明中のポリカーボネート樹脂の製造に 使用される前記一般式(A)のビスフェノール類として は、具体的には9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フル オレン、9,9-ビス(4-ヒドロキシー3ーメチルフェニ 20 ル)フルオレン、9,9-ビス(4-ヒドロキシー3-エチルフ ェニル)フルオレン等が用いられる。特に9,9-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)フルオレンが好適に使 用される。

【0012】本発明中のポリカーボネート樹脂の製造に 使用される前記一般式(B)の脂肪族ジヒドキシ化合物 は、トリシクロ (5. 2. 1. $0^{2.6}$) デカンジメタノー ル(以下、TCDDMと略称)である。また物性の観点 から、一般式(A)/一般式(B)のモル比は、70/ 30~5/95であり、より好ましくは、60/40~ 30 20/80である。

【0013】本発明中のポリカーボネート樹脂の製造に 使用される前記一般式(C)の芳香族ジヒドロキシ化合 物としては、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) ブタン、2,2-ビス (4-ヒドロキシフェニ ル)オクタン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニル メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニ ルエタン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)ジフェニルメ ~20のシクロアルキル基、炭素数6~20のシクロア 40 タン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)プ ロパン、1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-tertーブチルフェ ニル) プロパン、2,2-ビス (3,5-ジメチルー4-ヒドロキ シフェニル) プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシー3-フ ェニルフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-シクロヘキシ ルー4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒ ドロキシー3-ブロモシフェニル) プロパン、2,2-ビス (3,5-ジブロモー4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、2,2-ビ 50 ス(4-ヒドロキシー3-メトキシフェニル)プロパン、4,

4' - ジヒドロキシフェニルエーテル、4,4' - ジヒドロキ シー3,3'ージメチルフェニルエーテル、4,4'ージヒドロ キシフェニルスルフィド、4,4' - ジヒドロキシー3,3' -ジメチルジフェニルスルフィド、4,4'ージヒドロキシジ フェニルスルホキシド、4,4' - ジヒドロキシー3,3' - ジ メチルジフェニルスルホキシド、4,4'ージヒドロキシジ フェニルスルホン、4,4'ージヒドロキシー3,3'ージメチ ルジフェニルスルホン等が用いられる。

【0014】本発明においては前記一般式(C)の使用 量は、一般式(C)/[一般式(A)+一般式(B)] のモル比で、通常50/50~0/100であり、好ま しくは50/50~10/90である。

【0015】本発明のポリカーボネートは、ビスフェノ ールAと炭酸エステル形成化合物からポリカーボネート を製造する際に用いられている公知の方法、例えばビス フェノール類とホスゲンとの直接反応(ホスゲン法)、 あるいはビスフェノール類とビスアリールカーボネート とのエステル交換反応(エステル交換法)などの方法を 採用することができる。

【0016】炭酸エステル形成性化合物としては、例え 20 ばホスゲンや、ジフェニルカーボネート、ジーpートリ ルカーボネート、フェニル-p-トリルカーボネート、 ジーp-クロロフェニルカーボネート、ジナフチルカー ボネートなどのビスアリルカーボネートが挙げられる。 これらの化合物は2種類以上併用して使用することも可 能である。

【0017】ホスゲン法とエステル交換法では、TCD DMの反応性を考慮した場合、エステル交換法の方が好 ましい。

【0018】本発明に係わるポリカーボネート樹脂の製 30 造方法では、触媒として、塩基性化合物が用いられる。 このような塩基性化合物としては、特にアルカリ金属化 合物および/またはアルカリ土類化合物、含窒素化合物 等があげられる。

【0019】このような化合物としては、アルカリ金属 およびアルカリ土類金属化合物等の有機酸塩、無機塩 類、酸化物、水酸化物、水素化物あるいはアルコキシ ド、4級アンモニウムヒドロキシドおよびそれらの塩、 アミン類等が好ましく用いられ、これらの化合物は単独 もしくは組み合わせて用いることができる。

【0020】このようなアルカリ金属化合物として具体 的には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化セ シウム、水酸化リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナ トリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸リチウ ム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸セシウム、酢 酸リチウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カ リウム、ステアリン酸セシウム、ステアリン酸リチウ ム、水素化ホウ素ナトリウム、フェニル化ホウ素ナトリ ウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香

ム、リン酸水素2カリウム、リン酸水素2リチウム、フ ェニルリン酸2ナトリウム、ビスフェノールAの2ナト リウム塩、2カリウム塩、2セシウム塩、2リチウム 塩、フェノールのナトリウム塩、カリウム塩、セシウム 塩、リチウム塩等が用いられる。

【0021】また、アルカリ土類金属化合物としては、 具体的には、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、 水酸化ストロンチウム、水酸化バリウム、炭酸水素マグ ネシウム、炭酸水素カルシウム、炭酸水素ストロンチウ ム、炭酸水素バリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシ ウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム、酢酸マグネ シウム、酢酸カルシウム、酢酸ストロンチウム、酢酸バ リウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カル シウム、安息香酸カルシウム、フェニルリン酸マグネシ ウム等が用いられる。

【0022】また、含窒素化合物としては、具体的に は、テトラメチルアンモニウムヒドロキド、テトラエチ ルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニ ウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキ シド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキシド等 のアルキル、アリール、アルアリール基等を有する4級 アンモニウムヒドロキシド類、トリエチルアミン、ジメ チルベンジルアミン、トリフェニルアミン等の3級アミ ン類、ジエチルアミン、ジブチルアミン等の2級アミン 類、プロピルアミン、ブチルアミン等の1級アミン類、 2-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール等 のイミダゾール類、あるいは、アンモニア、テトラメチ ルアンモニウムボロハイドライド、テトラブチルアンモ ニウムボロハイドライド、テトラブチルアンモニウムテ トラフェニルボレート、テトラフェニルアンモニウムテ トラフェニルボレート等の塩基性塩等が用いられる。

【0023】これらの触媒は、前記一般式(A)、前記 一般式(B) および前記一般式(C) の合計量1モルに 対して、10-9~10-3モルの比率で、好ましくは10 -7~10-5モルの比率で用いられる。

【0024】本発明中のポリカーボネート樹脂の製造に 使用される一般式(A)で表される9,9-ビス(4-ヒドロ キシー3-メチルフェニル)フルオレン、前記一般式

(B) で表されるTCDDMおよび前記一般式(C)

は、純度99%以上に精製されたものが好ましく、純度 の低いものは黄着色度が大きくなり、反応性も低下し重 合の制御が困難となる。

【0025】本発明にかかわるエステル交換法は公知の 溶融重縮合法により行うことができる。即ち、一般式 (A)、一般式(B) および一般式(C) に、ビスアリ ールカーボネート及び触媒とを混合し、常圧または減圧 下で高温において反応させる。反応は通常120~35 0℃、好ましくは180~300℃の範囲の温度におい て行われ、また減圧度は最終で好ましくは1mmHg以下に 酸セシウム、安息香酸リチウム、リン酸水素2ナトリウ 50 して、エステル交換反応により生成した該ビスアリール カーボネートから由来するフェノール類を系外へ留去させる。反応時間は反応温度や減圧度などによって左右されるが、通常1~8時間程度である。反応は窒素やアルゴンなどの不活性ガス雰囲気下で行うことが好ましく。また、所望に応じ、分子量調節剤、酸化防止剤や分岐化剤を添加して反応を行ってもよい。

【0026】本発明の電子写真感光体は導電性支持体上に単一層の光導電層を有するものでも、機能分離した積層型のものでも良い。最近は、露光により電荷を発生する電荷発生層と、電荷を輸送する電荷輸送層との二層か 10 らなる積層型の電子写真感光体が主流となっている。 又、必要に応じて下引き層、保護層、接着層等を設けても良い。

【0027】本発明の導電性支持体とは、アルミニウム、ステンレス鋼、ニッケル等の金属材料や、又、表面にアルミニウム、パラジウム、酸化スズ、酸化インジウム等の導電性層を設けたポリエステルフィルム、フェノール樹脂、紙等が使用される。

【0028】本発明の電荷発生層は公知の方法により、 導電性支持体上に形成される。電荷発生物質としては、 20 例えば、アゾキシベンゼン系、ジスアゾ系、トリスアゾ 系、ベンズイミダゾール系、多環式キノリン系、インジ ゴイド系、キナクリドン系、フタロシアニン系、ペリレ ン系、メチン系等の有機類料が使用できる。これらの電 荷発生物質は、その微粒子をポリビニルブチラール樹 脂、ポリビニルホルマール樹脂、シリコーン樹脂、ポリ アミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポ リカーボネート樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、ポリ ウレタン樹脂、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、各種セ ルロース等のバインダー樹脂に分散させた形で使用され 30 る。

【0029】本発明の電荷輸送層は、電荷発生層上に公 知の方法により、本発明のポリカーボネート樹脂をバイ ンダー樹脂として、電荷輸送物質を分散させる事により 形成される。電荷輸送物質としては、例えば、ポリテト ラシアノエチレン; 2, 4, 7-トリニトロー9-フル オレノン等のフルオレノン系化合物; ジニトロアントラ セン等のニトロ化合物;無水コハク酸;無水マレイン 酸;ジブロモ無水マレイン酸;トリフェニルメタン系化 合物: 2, 5-ジ(4-ジメチルアミノフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール等のオキサジアゾール系 化合物;9-(4-ジエチルアミノスチリル)アントラ セン等のスチリル系化合物;ポリーN-ビニルカルバゾ ール等のカルバゾール系化合物;1-フェニル-3-(p-ジメチルアミノフェニル) ピラゾリン等のピラゾ リン系化合物; 4, 4', 4"-トリス(N, N-ジフ ェニルアミノ)トリフェニルアミン等のアミン誘導体; -ジフェニルー1, 3-ブタジエン等の共役不飽和化合 物;4-(N, N-ジエチルアミノ)ベンズアルデヒド 50 -N, N-ジフェニルヒドラゾン等のヒドラゾン系化合物;インドール系化合物、オキサゾール系化合物、イソオキサゾール系化合物、チアゾール系化合物、チアジアゾール系化合物、イミダゾール系化合物、ピラゾール系化合物、ピラゾリン系化合物、トリアゾール系化合物等の含窒素環式化合物;縮合多環式化合物等が挙げられる。上記電荷輸送物質は単独で使用しても、複数種併用しても良い。

【0030】これらの反応で合成されたポリカーボネート樹脂は、電子写真感光体製造で使用される溶液流延法、キャスト法、スプレー法、浸漬塗布法(ディップ法)等の公知湿式成形で容易に成形可能である。湿式成形で成形された電子写真感光体が十分な膜強度を得るためには極限粘度が0.3~2.0dl/gであることが好ましく、さらに成膜性と膜強度を重視した場合、0.4~1.5dl/gであることが好ましい。

【0031】電荷発生層及び電荷輸送層は、上記の電荷 発生物質、又は、電荷輸送物質を、それぞれバインダー 樹脂と、適当な溶媒に溶解させ、その溶液を浸漬塗布法 やスプレー法等により塗布し、乾燥させる事により形成 できる。この溶媒としては、ハロゲン系有機溶媒と非ハ ロゲン系溶媒の2種類に大別できるが、一般的に可燃性 が少ないハロゲン系溶媒が多用される。近年は、安全性 や環境保全の観点から、非ハロゲン系溶媒が使用される 比率が大きくなっており、本発明で用いられるポリカー ボネート樹脂も非ハロゲン系溶媒の多くに良溶である。 【0032】非ハロゲン系溶媒ではベンゼン、トルエ ン、キシレン等の芳香族系溶媒、アセトン、メチルエチ ルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、テトラ ヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジエチ ルエーテル等のエーテル系溶媒、酢酸メチル、酢酸エチ ル、エチルセロソルブ等のエステル系溶媒、メタノー ル、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系溶 媒、その他ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ ド、ジエチルホルムアミド等が挙げられる。またハロゲ ン系溶媒としては塩化メチレン、クロロホルム、四塩化 炭素、塩化エチレン、テトラクロロエタン、クロロベン ゼン等が挙げられ、これらの溶媒は非ハロゲン、ハロゲ ンを問わず単独で使用しても良く、又は、2種以上を併 40 用し混合用溶媒として使用しても良い。

【0033】電荷発生物質とバインダー樹脂の混合比は、10:1 \sim 1:20の範囲内が好ましい。この電荷発生層の厚さは、0.01 \sim 20 μ m、好ましくは0.1 \sim 2 μ mが好適である。

【0034】電荷輸送物質とバインダー樹脂との混合比は、 $10:1\sim1:10$ の範囲内が好ましい。この電荷輸送層の厚さは、 $2\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、好ましくは $5\sim30\,\mu\,\mathrm{m}$ が好適である。

[0035]

【実施例】以下、実施例及び比較例によって具体的に説

明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 【0036】実施例1

2, 2-EZ (4-Eドロキシフェニル)プロパン4. 56g (0.02モル)、9, 9-EZ (4-Eドロキシー3-Xチルフェニル)フルオレン22. 7g (0.06 モル)、トリシクロ($5.2.1.0^{2.6}$)デカンジメタノール23. 6g (0.12 モル)、ジフェニルカーボネート43. 4g (0.2 モル)、および炭酸水素ナトリウム $5\times10^{-5}g$ (6×10^{-7} モル)を攪拌機および留出装置付きの300 ミリリットル四ッロフラス 10 コに入れ、窒素雰囲気 760 mmHgの下180 に加熱し30 分間攪拌した。この時使用した芳香族ヒドロキシ化合物、TCDDM及びジフェニルカーボネートは純度 99%以上であった。

【0037】その後、減圧度を150mmHgに調整すると同時に、60℃/hrの速度で200℃まで昇温を行い、40分間その温度に保持しエステル交換反応を行った。さらに、75℃/hrの速度で225℃まで昇温し、昇温終了の40分後、その温度で保持しながら、1時間かけて減圧度を1mmHg以下とした。その後、105℃/hrの速度で260℃まで昇温し合計7時間攪拌下で反応を行い、反応終了後、反応器内に窒素を吹き込み常圧に戻し、生成したポリカーボネートを取り出した。この重合体の塩化メチレンを溶媒とする濃度0.5g/d1の溶液の20℃における極限粘度は0.45d1/gであった。

【0038】次に、アルミニウムを厚さ約50nm蒸着 したポリエチレンテレフタレートフィルム上に、
て型銅。 フタロシアニン10部とフェノキシ樹脂5部、ポリビニ ルブチラール樹脂 5部、ジメトキシエタン100部とを 30 混合し、サンドグラインドミルにて粉砕分散処理を行っ た塗布液を用いて塗布し、乾燥し、厚さ約0.5 μmの 電荷発生層を設けた。次に、4-(N, N-ジエチルア ミノ) ベンズアルデヒドーN, N-ジフェニルヒドラゾ ンを50部、上記合成重合により得られたポリカーボネ ート樹脂を50部、テトラヒドロフランを350部、使 用した塗布液を作製し、上記電荷発生層上に塗布し、風 乾後100℃、8時間乾燥し、厚さ約20μmの電荷輸 送層を設けて、積層型電子写真感光体を作製した。この 電子写真感光体の評価を、(株)川口電気製作所製EP A-8100静電気帯電試験装置にて、帯電特性を調べ た。また耐摩耗性については、スガ試験機株式会社製テ ーバ摩耗試験機を用いて削れ量を測定した。

【0039】実施例2

実施例1において、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン9, 15g(0, 04 モル)、9, 9-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)フルオレン22, 7g(0, 06 モル)、トリシクロ(5, 2.

1. 0^{2.6}) デカンジメタノール19. 6 g (0. 10 モル) を使用する以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の極限粘度は0.50dl/gであった。また、電子写真感光体成形および物性評価も実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

10

【0040】実施例3

実施例1において、2、2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン9.15g(0.04モル)、9、9ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)フルオレン15.1g(0.06モル)、トリシクロ(5.2.1.0 $^{2.6}$)デカンジメタノール23.6g(0.10モル)を使用する以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の極限粘度は0.47dl/gであった。また、電子写真感光体成形および物性評価も実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0041】実施例4

実施例1において、9,9ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)フルオレン22.7g(0.06モル)、トリシクロ(5.2.1.0^{2.6})デカンジメタノール27.5g(0.14モル)を使用し、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを使用しない以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の極限粘度は0.46dl/gであった。また、電子写真感光体成形および物性評価も実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0042】実施例5

実施例1において、9,9ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)フルオレン27.3g(0.07モル)、トリシクロ(5.2.1.0^{2.6})デカンジメタノール26.4g(0.13モル)を使用し、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを使用しない以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の極限粘度は0.48dl/gであった。また、電子写真感光体成形および物性評価も実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0043】比較例1

実施例1のポリカーボネート樹脂の代わりに、市販のBPZ型ホモポリカーボネート樹脂(三菱ガス化学(株)製ユーピロンPCZ、極限粘度0.78dl/g)を用いて、実施例1と同様の評価試験を行った。結果を表1に示す。【0044】比較例2

実施例1のポリカーボネート樹脂の代わりに、市販のBPA型ホモポリカーボネート樹脂(三菱ガス化学(株)製ユーピロンE-1000、極限粘度0.61dl/g)を用いて、実施例1と同様の評価試験を行った。結果を表1に示す。

[0045]

【表1】

	バインダー樹脂組成		電子写真感光体特性			
	願料モノマー (モル比)	極限粘度 (d1/g)	初期電位 (-V)	残留電位 (-V)	磨耗量 (mg)	
実施例1	BPA/ECFL/TCDOM (10/30/60)	0.45	611	2 1	2. 5	
実施例 2	BPA/BCFL/TCDDM (20/30/50)	0.50	610	2 2	2. 9	
実施例3	BPA/BCFL/TCDDM (20/20/60)	0.47	623	2 2	2. 9	
実施例 4	BCFL/TCDDM (30/70)	0.46	617	2 0	2. 5	
実施例 5	BCFL/TCDDM (35/65)	0.48	6 1 2	1 9	2. 3	
比較例 1	BPZ (100)	0.78	6 1 3	18	3. 1	
比較例 2	BPA (100)	0.61	621	2 6	3. 5	

【0046】 (表1の記載の説明)

BPA : 2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン

ヘキサン

BCFL:9, 9-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェ ニル)フルオレン

TCDDM: トリシクロ (5. 2. 1. $0^{2.6}$) デカンジメタノ

極限粘度:20℃、0.5%ジクロロメタン溶液、ハギ ンズ定数0.45で測定。

初期電位:DC帯電器にて50 µ A電流が流入するよう調整*

*したときの初期帯電量(-V)。

残留電位:露光 (除電10Lux)後、4秒後の残留電位 (-V) 。

BPZ : 1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) シクロ 20 磨耗量 : 荷重300g、CS-17 輪、1000回往復運動後のテ ーバ摩耗試験を行った際の磨耗量(mg)

[0047]

【発明の効果】本発明の電子写真感光体は、ビスクレゾ ールフルオレン及びTCDDMより誘導されたコポリカ ーボネート樹脂をバインダーに使用することにより、電 子写真感光体の帯電特性を維持したまま耐磨耗性が向上 する。そのため電子写真画像の安定化や感光体寿命延長 効果が期待される。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H068 AA13 BB20 BB26 BB53 4J029 AA09 AB07 AC02 AD01 AE18 BB08A BB13A BD02 BF14A BH02 CE04 DB07 DB11 DB13 HC01 HC02 HC03 HC04A HC05A JA121 JB171 JC091 JC221 JC531 JC731 JF021 JF031 JF041 JF051 JF131 JF141 JF151 KE02 KE05